

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年7月11日(11.07.2024)



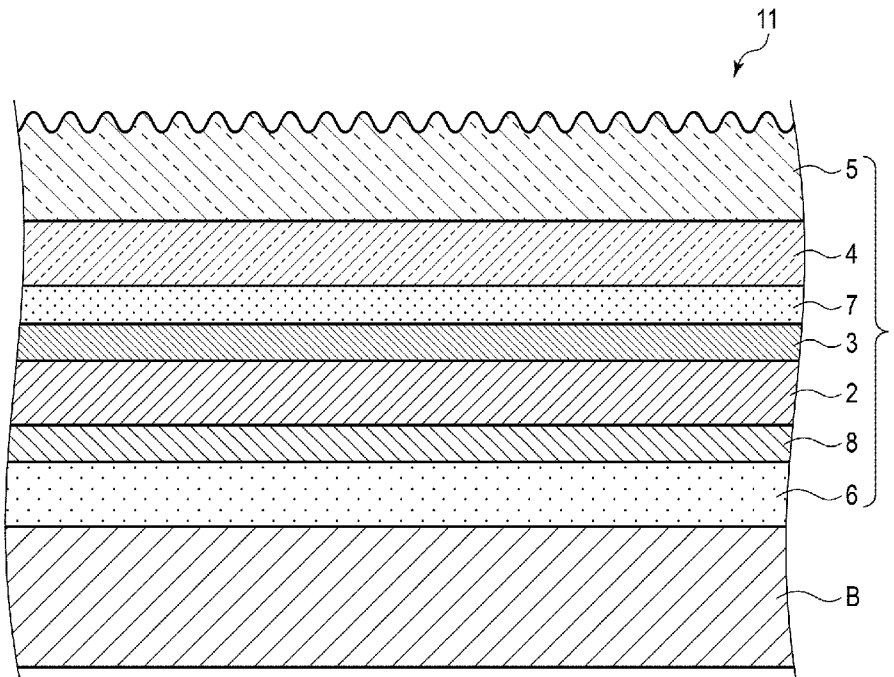
(10) 国際公開番号

WO 2024/147318 A1

- (51) 国際特許分類:
B32B 3/30 (2006.01) *B32B 27/00* (2006.01)
B32B 7/023 (2019.01) *B32B 27/16* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2023/046694
- (22) 国際出願日: 2023年12月26日(26.12.2023)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2023-000275 2023年1月4日(04.01.2023) JP
- (71) 出願人: T O P P A N ホールディングス株式会社(TOPPAN HOLDINGS INC.) [JP/JP]; 〒1100016 東京都台東区台東一丁目5番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 山崎 祥美(YAMASAKI, Yoshimi); 〒1100016 東京都台東区台東一丁目5番1号 T O P P A Nホールディングス株式会社内 Tokyo (JP). 森田 まち子(MORITA, Machiko); 〒1100016 東京都台東区台東一丁目5番1号 T O P P A Nホールディングス株式会社内 Tokyo (JP). 阿久津 絵理佳(AKUTSU, Erika); 〒1100016 東京都台東区台東一丁目5番1号 T O P P A Nホールディングス株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 弁理士法人鈴榮特許総合事務所(SUZUYE & SUZUYE); 〒1050014 東京都港区芝三丁目23番1号 セレスティン芝三井ビルディング11階 Tokyo (JP).

(54) Title: DECORATIVE SHEET

(54) 発明の名称: 化粧シート



(57) Abstract: The present invention provides a decorative sheet which has a rough texture. A decorative sheet 1 is provided with: a master layer 2; and a surface protection layer 5 that is provided on one surface of the master layer 2. The surface of the surface protection layer 5 is provided with a relief structure that comprises a plurality of ridge parts, each protruding in the form of a ridge. The relief structure of the surface protection layer 5 has a profile peak height R_{pk} of 3.5 μm or more. With respect to the surface protection layer, the mass concentration C (% by mass) of carbon atoms, the

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

mass concentration O (% by mass) of oxygen atoms, and the mass concentration Si (% by mass) of silicon atoms satisfy the relational expression $0.5 \leq (\text{Si}/(\text{C} + \text{O} + \text{Si})) \times 100$.

(57) 要約: ざらざらした触感を与える化粧シートを提供する。化粧シート 1 は、原反層 2 と、上記原反層 2 の一方の表面に設けられた表面保護層 5 とを備え、上記表面保護層 2 の表面に、各々が畝状に突出した複数の畝状部を含んだ凹凸構造が設けられており、上記表面保護層 5 の上記凹凸構造は、突出山部高さ R_p が $3.5 \mu\text{m}$ 以上であり、上記表面保護層は、炭素原子の質量濃度 C (質量%) と酸素原子の質量濃度 O (質量%) とケイ素原子の質量濃度 Si (質量%) とが、以下の関係式: $0.5 \leq \{\text{Si} / (\text{C} + \text{O} + \text{Si})\} \times 100$ を満たす。

明 細 書

発明の名称：化粧シート

技術分野

[0001] 本発明は、化粧シートに関する。

背景技術

[0002] 化粧シートは、例えば、建具、家具、造作材、及び床材等の内外装材へ意匠性や耐久性を付与する目的で、それらの表面化粧に使用される。化粧シートは、一般に、木材、木質ボード、金属板、不燃ボード、紙質基板、及び樹脂基板等の基板の表面に接着剤などを介して貼り付けてなる化粧板として広く用いられている。

[0003] 意匠性は、例えば、木目や石目といった柄を、各種印刷方法を用いて形成することによって付与する。化粧シートには、柄がない無地が好まれることもある。柄の有無や柄の種類の選択は、用途や嗜好に応じて様々である。

[0004] 化粧シートの意匠性には、表面の光沢感も重要である。化粧シートとしては、用途や嗜好に応じて、鏡面のような高光沢なものから、映り込みが全くない低光沢なものまで、様々なものが選ばれる。

[0005] また、前述の通り、意匠性の付与と並んで重要な化粧シートの機能として、耐久性の付与が挙げられる。耐久性とは、耐傷性や耐汚染性、更にそれらが長期間継続して担保されるかを総合的に評価したものである。化粧シートが使用される環境や状況により、要求は異なってくるが、常に高い性能を有する化粧シートが求められている。

[0006] 耐久性の付与には、化粧シートの最表面に表面保護層を形成するのが一般的である。また、前述の光沢感を調整するため、特に低光沢を達成するためには、表面保護層中に艶調整剤（艶消し添加剤）を添加することが一般的である。

[0007] 更に、化粧シートは、化粧板などの化粧材を形成するために切削や曲げといった加工が施されるのが一般的なため、これらに耐え得る加工性を有する

ことが好ましい。

[0008] このように、意匠性（低光沢）、耐傷性、耐汚染性が考慮された化粧シートとして、例えば特許文献1に記載の化粧シートがある。

先行技術文献

特許文献

[0009] 特許文献1：日本国特開2019-119138号公報

発明の概要

[0010] 本発明は、ざらざらした触感を与え、且つ触感の均一性に優れた化粧シートを提供することを目的とする。

[0011] 本発明の一側面によると、原反層と、上記原反層の一方の表面に設けられた表面保護層とを備え、上記表面保護層の表面に、各々が畝状に突出した複数の畝状部を含んだ凹凸構造が設けられており、上記表面保護層の上記凹凸構造は、突出山部高さ Rpk が $3.5\mu m$ 以上であり、上記表面保護層は、炭素原子の質量濃度 C （質量％）と酸素原子の質量濃度 O （質量％）とケイ素原子の質量濃度 Si （質量％）とが、以下の関係式：

$$0.5 \leq \{Si / (C + O + Si)\} \times 100$$

を満たす化粧シートが提供される。

[0012] 本発明の他の側面によると、上記突出山部高さ Rpk は $25\mu m$ 以下である上記側面に係る化粧シートが提供される。

[0013] 本発明の他の側面によると、上記表面保護層は、炭素原子の質量濃度 C （質量％）と酸素原子の質量濃度 O （質量％）とケイ素原子の質量濃度 Si （質量％）とが、以下の関係式：

$$0.5 \leq \{Si / (C + O + Si)\} \times 100 \leq 5.0$$

を満たす上記側面の何れかに係る化粧シートが提供される。

[0014] 本発明の更に他の側面によると、上記表面保護層の上記凹凸構造は、粗さ曲線要素の平均長さ RSm が $150\mu m$ 以上である上記側面の何れかに係る化粧シートが提供される。

[0015] 本発明の更に他の側面によると、上記平均長さ RSm は $600\mu m$ 以下で

ある上記側面に係る化粧シートが提供される。

[0016] 本発明の更に他の側面によると、上記表面保護層の厚さは $8\ \mu\text{m}$ 以上である上記側面の何れかに係る化粧シートが提供される。

[0017] 本発明の更に他の側面によると、上記表面保護層の光沢度は 10.0 以下である上記側面の何れかに係る化粧シートが提供される。

[0018] 本発明の更に他の側面によると、上記複数の畝状部の少なくとも一部は幅方向へ隣り合い、上記複数の畝状部の上記少なくとも一部が上記幅方向へ隣り合った位置で、上記幅方向及び上記表面保護層の厚さ方向に平行な断面は、上記凹凸構造が設けられた部分が正弦波形状を有している上記側面の何れかに係る化粧シートが提供される。

[0019] 本発明の更に他の側面によると、上記表面保護層は、電離放射線硬化性樹脂の硬化物を含んだ上記側面の何れかに係る化粧シートが提供される。

[0020] 本発明の更に他の側面によると、上記電離放射線硬化性樹脂は、主成分が繰り返し構造を含むアクリレートであり、上記繰り返し構造は、エチレンオキサイド、プロピレンオキサイド、及び ε -カプロラク톤の何れかであり、上記繰り返し構造の繰り返し回数は 3 以上である上記側面に係る化粧シートが提供される。

[0021] 本発明の更に他の側面によると、上記側面の何れかに係る化粧シートと、上記化粧シートが貼り付けられた基材とを備えた化粧材が提供される。

[0022] 本発明によれば、ざらざらした触感を与え、且つ触感の均一性に優れた化粧シートを提供することが可能となる。

図面の簡単な説明

[0023] [図1]図1は、本発明の一実施形態に係る化粧シートを含んだ化粧材の断面図である。

[図2]図2は、図1の化粧シートが含んでいる表面保護層の断面図である。

[図3]図3は、本発明の一例に係る化粧シートが含んでいる表面保護層の顕微鏡画像である。

発明を実施するための形態

[0024] 以下に、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。以下に説明する実施形態は、上記側面の何れかをより具体化したものである。以下に記載する事項は、単独で又は複数を組み合わせて、上記側面の各々に組み入れることができる。

[0025] また、以下に示す実施形態は、本発明の技術的思想を具体化するための構成を例示するものであって、本発明の技術的思想は、下記の構成部材の材質、形状、及び構造等によって限定されるものではない。本発明の技術的思想には、請求の範囲に記載された請求項が規定する技術的範囲内において、種々の変更を加えることができる。

[0026] なお、同様又は類似した機能を有する要素については、以下で参照する図面において同一の参照符号を付し、重複する説明は省略する。また、図面は模式的なものであり、或る方向の寸法と別の方向の寸法との関係、及び、或る部材の寸法と他の部材の寸法との関係等は、現実のものとは異なり得る。

[0027] < 1 >化粧材及び化粧シート

図 1 は、本発明の一実施形態に係る化粧シートを含んだ化粧材の断面図である。図 2 は、図 1 の化粧シートが含んでいる表面保護層の断面図である。図 3 は、本発明の一例に係る化粧シートが含んでいる表面保護層の顕微鏡写真である。

[0028] なお、図 2 に示す断面は、表面保護層の厚さ方向に沿った断面である。また、図 3 の顕微鏡写真は、レーザ顕微鏡（オリンパス社製 OLS-4000）により得た平面写真である。

[0029] 図 1 に示す化粧材 11 は、基材 B と、これに貼り付けられた化粧シート 1 とを含んでいる。ここでは、化粧材 11 は、化粧板である。化粧板は、平板であってもよく、曲げられているか又は折られていてもよい。化粧材 11 は、板以外の形状を有していてもよい。

[0030] 基材 B は、ここでは、板材である。板材は、例えば、木質ボード、無機質ボード、金属板、又は、複数の材料からなる複合板である。基材 B は、板以外の形状を有していてもよい。

[0031] 化粧シート1は、原反層2と、絵柄層3と、透明樹脂層4と、表面保護層5と、接着層7と、プライマ層6と、隠蔽層8とを含んでいる。絵柄層3、接着層7、透明樹脂層4、及び表面保護層5は、原反層2の基板Bと向き合った面とは反対側の面に、原反層2側からこの順に設けられている。隠蔽層8及びプライマ層5は、原反層2の基板Bと向き合った面に、原反層2側からこの順に設けられている。絵柄層3、透明樹脂層4、プライマ層6、接着層7、及び隠蔽層8の1以上は省略してもよい。以下に、化粧シート1が含まれている要素について、順次説明する。

[0032] <1. 1>原反層

原反層2又はその材料としては、例えば、紙、合成樹脂、合成樹脂の発泡体、ゴム、不織布、合成紙、金属箔等から任意に選定したものが使用可能である。紙としては、薄葉紙、チタン紙、樹脂含浸紙等が例示できる。合成樹脂としては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブチレン、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリアミド、エチレン-酢酸ビニル共重合体、ポリビニルアルコール、アクリル等が例示できる。ゴムとしては、エチレン-プロピレン共重合ゴム、エチレン-プロピレン-ジエン共重合ゴム、スチレン-ブタジエン共重合ゴム、スチレン-イソプレネ-スチレンブロック共重合ゴム、スチレン-ブタジエン-スチレンブロック共重合ゴム、ポリウレタン等が例示できる。不織布としては、有機系や無機系の不織布が使用できる。金属箔の金属としては、アルミニウム、鉄、金、銀等が例示できる。

[0033] 原反層2の層厚は、印刷作業性やコストなどを考慮すれば、20 μm 以上250 μm 以下の範囲内が好ましい。

[0034] <1. 2>プライマ層

原反層2の材料としてオレフィン系の樹脂を用いる場合には、原反層2の表面が不活性な状態であることが多い。従って、この場合、原反層2と基材Bとの間に、プライマ層6を設けることが好ましい。原反層2がオレフィン系材料からなる場合、プライマ層6を省略するとともに、原反層2と基材B

との接着性を向上させるために、原反層 2 に対して、例えば、コロナ処理、プラズマ処理、オゾン処理、電子線処理、紫外線処理、重クロム酸処理等の表面改質処理を施してもよい。

[0035] プライマ層 6 の材料としては、例えば、絵柄層 3 について後述する材料を用いることができる。プライマ層 6 は、化粧シート 1 の裏面に施されることから、化粧シート 1 がウェブ状に巻取りされることを考慮すると、ブロッキングを避けて且つ接着剤との密着力を高めるために、プライマ層 6 に無機充填剤を添加してもよい。無機充填剤としては、シリカ、アルミナ、マグネシア、酸化チタン、硫酸バリウム等が例示できる。

[0036] < 1. 3 > 隠蔽層

基材 B に対する隠蔽性を化粧シート 1 に付与するには、例えば、原反層 2 として着色シートを用いるか、又は、不透明な隠蔽層 8 を設ける。隠蔽層 8 は、例えば、絵柄層 3 について後述するものと同じ材料から構成することができる。但し、隠蔽層 8 は、隠蔽性を目的としているので、顔料としては、例えば、不透明な顔料、酸化チタン、酸化鉄等を使用することが好ましい。また、隠蔽性を高めるために、隠蔽層 8 の材料には、例えば、金、銀、銅、アルミニウム等の金属を添加することも可能である。一般的には、フレーク状のアルミニウム片を添加させることが多い。

[0037] < 1. 4 > 絵柄層

絵柄層 3 は、原反層 2 に対して、インキを用いて絵柄を印刷してなる層である。インキのバインダとしては、例えば、硝化綿、セルロース、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、ポリビニルブチラール、ポリウレタン、アクリル、ポリエステル類、又は、それらの変性物を、単独で又は複数を組み合わせて用いることができる。バインダは、水性、溶剤系、エマルジョンタイプの何れでもよく、1 液タイプでも硬化剤を使用した 2 液タイプでもよい。絵柄層 3 は、硬化性のインキで形成した層を、紫外線や電子線等の照射により硬化させる方法により形成してもよい。中でも最も一般的な方法は、ウレタン系のインキを用いるもので、イソシアネートによって硬化させる方法である。

。絵柄層 3 を形成するために使用するインキは、バインダ以外には、例えば、通常のインキに含まれている顔料、染料等の着色剤、体質顔料、溶剤、各種添加剤などを更に含むことができる。汎用性の高い顔料としては、例えば、縮合アゾ、不溶性アゾ、キナクリドン、イソインドリン、アンスラキノン、イミダゾロン、コバルト、フタロシアニン、カーボン、酸化チタン、酸化鉄、雲母等のパール顔料等が挙げられる。

[0038] また、インキの塗布とは別に、各種金属の蒸着やスパッタリングで、絵柄層 3 に意匠を施すことも可能である。特に、上記インキには、光安定剤が添加されていることが好ましい。これにより、インキの光劣化から生じる化粧シート 1 自体の劣化を抑制し、化粧シート 1 の寿命を長くすることができる。

[0039] < 1. 5 > 接着層

接着層 7 は、感熱接着層、アンカーコート層、ドライラミ接着剤層とも呼ばれる層である。

[0040] 接着層 7 の樹脂材料は特に限定されるものではないが、例えば、アクリル系、ポリエステル系、ポリウレタン系、エポキシ系などの樹脂材料から適宜選択して用いることができる。また、接着層 7 の樹脂材料として、例えば、エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂系接着剤も用いることができる。塗工方法は、接着剤の粘度などに応じて適宜選択することができる。一般的には、グラビアコートが用いられ、絵柄層 3 の上面に対してグラビアコートによって接着層 7 を形成した後、透明樹脂層 4 がラミネートされる。なお、接着層 7 は、透明樹脂層 4 と絵柄層 3 との間に十分な接着強度が得られる場合には、省略することができる。

[0041] < 1. 6 > 透明樹脂層

透明樹脂層 4 の樹脂材料としては、オレフィン系樹脂が好適に用いられる。オレフィン系樹脂としては、例えば、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリブテンなどの他に、 α オレフィン（例えば、プロピレン、1-ブテン、1-ペンテン、1-ヘキセン、1-ヘプテン、1-オクテン、1-ノネン、1

ーデセン、1ーウンデセン、1ードデセン、トリデセン、1ーテトラデセン、1ーペンタデセン、1ーヘキサデセン、1ーヘプタデセン、1ーオクタデセン、1ーノナデセン、1ーエイコセン、3ーメチルー1ーブテン、3ーメチルー1ーペンテン、3ーエチルー1ーペンテン、4ーメチルー1ーペンテン、4ーメチルー1ーヘキセン、4, 4ージメチルー1ーペンテン、4ーエチルー1ーヘキセン、3ーエチルー1ーヘキセン、9ーメチルー1ーデセン、11ーメチルー1ードデセン、12ーエチルー1ーテトラデセンなど)を単独重合させたもの又はそれらの二種類以上を共重合させたものや、エチレンー酢酸ビニル共重合体、エチレンービニルアルコール共重合体、エチレンーメチルメタクリレート共重合体、エチレンーエチルメタクリレート共重合体、エチレンーブチルメタクリレート共重合体、エチレンーメチルアクリレート共重合体、エチレンーエチルアクリレート共重合体、エチレンーブチルアクリレート共重合体などのように、エチレン又は α オレフィンとそれ以外のモノマーとを共重合させたものが挙げられる。

[0042] また、化粧シート1の表面強度の向上を図るために、透明樹脂層4の樹脂として、高結晶性のポリプロピレンを用いることが好ましい。なお、透明樹脂層4には、必要に応じて、例えば、熱安定剤、光安定剤、ブロッキング防止剤、触媒捕捉剤、着色剤、光散乱剤、及び艶調整剤等の各種添加剤を添加することもできる。熱安定剤としては、フェノール系、硫黄系、リン系、ヒドラジン系等を、光安定剤としては、ヒンダードアミン系等を、それぞれ任意の組合せで添加するのが一般的である。

[0043] <1. 7>表面保護層

表面保護層5は、コア部5Aと、各々がコア部5Aの一方の面から畝状に突出した複数の畝状部5Bとを含んでいる。これら畝状部5Bは、凹凸形構造を形成している。

[0044] ここで、本実施形態に係る化粧シート1において、「畝状」とは、平面視で線状である凸形状をいう。畝状部5Bは、平面視での形状が、曲線状であっても直線状であってもよいが、化粧シート1の耐指紋性の観点から曲線状

であることが好ましい。畝状部 5 B の各々は、平面視で分岐していてもよく、分岐していなくてもよい。また、本開示において、畝状部 5 B は、例えば、表面保護層 5 の表面に設けられた凹凸形状の最も低い部分から先端までの部分であり、コア部 5 A は表面保護層 5 のうち畝状部 5 B を除いた部分をいうものとする。

[0045] 畝状部 5 B は、例えば、図 3 に示すように、各々が湾曲しており、少なくとも一部は幅方向へ隣り合っている。畝状部 5 B の少なくとも一部が幅方向へ隣り合った位置で、この幅方向及び表面保護層 5 の厚さ方向に平行な表面保護層 5 の断面は、図 2 に示すように、凹凸構造が設けられた部分が正弦波形状などの波形状を有している。

[0046] 表面保護層 5 の凹凸構造は、突出山部高さ $R_p k$ が $3.5 \mu m$ 以上である。ここで、「突出山部高さ $R_p k$ 」は、JIS B 0671-2:2002 に規定された表面性状パラメータである。この突出山部高さ $R_p k$ は、 $4.5 \mu m$ 以上であることがより好ましく、 $7.0 \mu m$ 以上であることが更に好ましい。この突出山部高さ $R_p k$ を小さくした化粧シートは、ユーザが表面保護層の表面上で肌を滑らせたときに、例えば、表面保護層の表面上で指を滑らせたときに、ユーザへざらざらした触感を与えない。

[0047] この突出山部高さ $R_p k$ は、 $25 \mu m$ 以下であることが好ましく、 $20 \mu m$ 以下であることがより好ましく、 $15 \mu m$ 以下であることが更に好ましい。この突出山部高さ $R_p k$ が大きな化粧シートは、高い再現性で製造することが難しい。

[0048] 表面保護層 5 の凹凸構造は、粗さ曲線要素の平均長さ $R_S m$ が $150 \mu m$ 以上であることが好ましく、 $200 \mu m$ 以上であることがより好ましく、 $250 \mu m$ 以上であることが更に好ましい。ここで、「粗さ曲線要素の平均長さ $R_S m$ 」は、JIS B 0601:2013 に規定された表面性状パラメータである。ユーザが表面保護層の表面上で肌を滑らせたときに、例えば、表面保護層の表面上で指を滑らせたときに、ユーザへざらざらした触感を与えるうえでは、粗さ曲線要素の平均長さ $R_S m$ は、上記の範囲内にあることが

好ましい。

[0049] この平均長さ RS_m は、 $600\mu m$ 以下であることが好ましく、 $550\mu m$ 以下であることがより好ましく、 $500\mu m$ 以下であることが更に好ましい。この平均長さ RS_m を大きくすると、ユーザが表面保護層の表面上で肌を滑らせたときに、畝状部 5 B の存在を知覚する頻度が少なくなる可能性がある。

[0050] 表面保護層 5 は、炭素原子の質量濃度 C (質量%) と酸素原子の質量濃度 O (質量%) とケイ素原子の質量濃度 Si (質量%) とが、以下の関係式 (1) を満たす。

$$0.5 \leq \{Si / (C + O + Si)\} \times 100 \quad (1)$$

ここで表面保護層 5 は、後述する電離放射線硬化性樹脂とシリカ粒子を含有する。表面保護層 5 が上記関係式 (1) を満たす場合、広い領域にわたって畝状部 5 B を均一に生じさせることが可能となり、触感の均一性が向上する。同様の観点から、 $\{Si / (C + O + Si)\} \times 100$ の値は、0.75 以上であることが好ましく、1 以上であることがより好ましい。

[0051] 表面保護層 5 は、 C (質量%) と O (質量%) と Si (質量%) とが以下の関係式 (2) を満たすことが好ましい。

$$0.5 \leq \{Si / (C + O + Si)\} \times 100 \leq 5.0 \quad (2)$$

$\{Si / (C + O + Si)\} \times 100$ の値が 5.0 以下であることは、耐傷性、耐汚染性、耐候性等の観点から好ましい。同様の観点から、 $\{Si / (C + O + Si)\} \times 100$ の値は、3.5 以下であることがより好ましく、2.0 以下であることが更に好ましい。

[0052] ・SEM-EDX 分析 (走査型電子顕微鏡-エネルギー分散型 X 線分析)
表面保護層 5 に含有される C (質量%)、 O (質量%) 及び Si (質量%) の測定は、走査型電子顕微鏡 (SEM; Scanning Electron Microscope) 観察及びエネルギー分散型 X 線分析 (EDX; Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) により行うことができる。EDX は、電子線照射により発生する特

性X線を検出し、エネルギーで分光することにより、元素分析を行う手法である。ここでは、SEMとして日立ハイテク製 Regulus 8220を使用し、EDX装置としてSEMに付属したOxford製 AZtec Live/Ultim Max 170を用い、下記分析条件にて行った。

[0053] ・分析条件

表面保護層5の表面に導電処理(Ptスパッタ 40mA、20秒)を施し、トップコート面についてSEM-EDX分析を下記条件において行った。

加速電圧 : 15 kV
エミッション電流 : 10 μ A
プローブ電流 : High
コンデンサレンズ : 1
測定時間 : 60 秒
測定倍率 : 500 倍

[0054] 本実施形態に係る化粧シート1は、以下に説明する通り、ざらざらした触感の均一性に優れる。

図3は、本発明の一例に係る化粧シートを撮像することによって得られた顕微鏡写真である。この顕微鏡写真は、一辺が数百マイクロメートル程度の矩形状の微小領域を表示している。

[0055] 図3の顕微鏡写真に示す微小領域では、畝状部5Bに対応する皺は均一に形成されている。皺の均一性は、触感の均一性へ寄与する。従って、ざらざらした触感の均一性に優れる化粧シートは、例えば、図3の顕微鏡写真に示されるように、皺が均一に存在している必要がある。

[0056] しかしながら、このような特定の微小領域において皺が均一に存在している場合であっても、他の領域には、図3に示される皺とは異なった形態の皺が存在しているか、又は、皺が形成されていない箇所が含まれていることがある。表面保護層5の表面全体に亘って皺が均一に存在しているか否かは、上記のような寸法を有している特定の微小領域を撮像することによって取得した顕微鏡画像を観察することや、化粧シートを肉眼で観察することでは確

認できない場合がある。そして、表面保護層 5 の表面で皺が均一に存在していない場合には、特定の微小領域を撮像することによって取得した顕微鏡画像を観察することや、化粧シートを肉眼で観察することで皺の不均一性を確認できなかったときであっても、この不均一さは、ユーザが表面保護層 5 の表面上で肌を滑らせた際に、異なった触感として知覚され得る。

[0057] 化粧シート 1 は、後述する方法によって得ることができる。そして、この化粧シート 1 は、上述した特徴を有している。このような化粧シート 1 は、その表面保護層 5 の表面上でユーザが肌を滑らせた際に、ユーザへざらざらした触感を与えるとともに、このざらざらした触感の均一性に優れている。

[0058] 表面保護層 5 の厚さは、 $8\ \mu\text{m}$ 以上であることが好ましく、 $10\ \mu\text{m}$ 以上であることがより好ましく、 $15\ \mu\text{m}$ 以上であることが更に好ましい。表面保護層 5 の厚さを小さくすると、突出山部高さ R_{pk} や平均長さ R_{Sm} を大きくすることが難しくなる。表面保護層 5 の厚さを大きくすると、突出山部高さ R_{pk} や平均長さ R_{Sm} が大きくなり易い。表面保護層 5 の厚さに上限はないが、コスト等の観点から、 $30\ \mu\text{m}$ 以下であることが好ましく、 $25\ \mu\text{m}$ 以下であることがより好ましい。

[0059] ここで、表面保護層 5 の厚さは、表面保護層 5 と見かけ上の面積及び体積が等しく且つ表面が平坦な層の厚さである。表面保護層 5 の厚さは、例えば、以下の方法により求める。まず、表面保護層 5 の厚さ方向に平行であり且つ畝状部 5 B の長さ方向に垂直な断面を撮像する。次に、この断面画像から、畝状部 5 B の幅方向における表面保護層 5 の寸法と、表面保護層 5 の断面の面積とを求める。表面保護層 5 の厚さは、この面積を上記の寸法で割ることにより得られる値である。

[0060] なお、後述する表面保護層用塗液が溶媒を含んでいない場合、表面保護層用塗液からなる塗膜の厚さは、表面保護層 5 の厚さと等しい。

[0061] 表面保護層 5 の光沢度は、 10.0 以下であることが好ましく、 8.0 以下であることがより好ましい。ここで、「光沢度」は、JIS Z 8741 : 1997 に準拠した光沢度計を用いて入射角 60 度で測定した場合の測定値

である。

[0062] <2>化粧シートの製造方法

化粧シート1は、例えば、以下の方法により製造する。ここでは、簡略化のため、絵柄層3、透明樹脂層4、プライマ層6、接着層7、及び隠蔽層8に関する説明は省略する。

[0063] 先ず、原反層2の一方の面に、表面保護層用塗液からなる塗膜を形成する。この塗膜は、例えば、グラビア印刷法、オフセット印刷法、スクリーン印刷法、静電印刷法、インクジェット印刷法等の各種印刷法や、ロールコート法、ナイフコート法、マイクログラビアコート法、ダイコート法等の各種コーティング法によって形成することができる。

[0064] 表面保護層用塗液は、電離放射線硬化性樹脂を含んでいる。ここで、「電離放射線」は、電子線などの荷電粒子線である。電離放射線硬化性樹脂は、電離放射線の照射によって硬化する。また、電離放射線硬化性樹脂は、紫外線照射によっても硬化し得る。ここで使用する電離放射線硬化性樹脂は、波長が200nm以下の光を照射することによって硬化する一方で、この光に対する吸収係数が大きい。

[0065] 表面保護層用塗液において、その固形分全量を100質量部とした場合、電離放射線硬化性樹脂の量は、60質量部以上であることが好ましく、70質量部以上であることがより好ましく、80質量部以上であることが更に好ましい。電離放射線硬化性樹脂としては、各種モノマーや市販されているオリゴマーなど、公知のものをを用いることができ、例えば、(メタ)アクリル系樹脂、シリコン系樹脂、ポリエステル系樹脂、ウレタン系樹脂、アミド系樹脂、エポキシ系樹脂を使用できる。電離放射線硬化性樹脂は、水系樹脂又は非水系(有機溶剤系)樹脂の何れであってもよい。

[0066] 電離放射線硬化性樹脂の主成分は、アクリレートであることが好ましい。ここで、電離放射線硬化性樹脂の主成分とは、電離放射線硬化性樹脂が含む全固形分を100質量部とした場合に、60質量部以上であることを意味する。電離放射線硬化性樹脂は、アクリレートを70質量部以上の量で含んで

いることが好ましく、80質量部以上の量で含んでいることがより好ましい。

[0067] アクリレートは、2官能以上のアクリレートであることが好ましく、3官能以上のアクリレートであることがより好ましい。耐傷性に優れた表面保護層5を得るうえでは、アクリレートは3官能以上であることが好ましい。アクリレートの官能基数に上限はないが、一例によれば6官能以下である。

[0068] アクリレートは、繰り返し構造を含んでいることが好ましい。この繰り返し構造は、例えば、エチレンオキサイド（EO）構造、プロピレンオキサイド（PO）構造、及びε-カプロラクトン（CL）構造の何れかである。繰り返し構造は、エチレンオキサイド又はプロピレンオキサイドであることが好ましい。繰り返し構造を含んだ3官能以上のアクリレートにおいて、上記の繰り返し構造は、開環した状態でアクリロイル基とメチロール基との間に介在し得る。

[0069] 繰り返し構造の繰り返し回数は3以上であることが好ましい。この繰り返し回数が多いアクリレートを使用すると、後述する第2照射工程において、硬化膜の面内方向への膨張が生じ易くなり、それ故、畝状部5Bに対応した皺が塗膜表面に生じ易くなる。また、広い領域にわたって皺を均一に生じさせることが可能となり、触感の均一性を向上させることに寄与する。但し、この繰り返し回数を多くすると、架橋密度が低下し、表面保護層の耐傷性が低下する。

[0070] 繰り返し構造を含んだ3官能のアクリレートは、例えば、EO変性、PO変性又はCL変性させた、トリメチロールプロパントリアクリレート、グリセリントリアクリレート、イソシアヌレートトリアクリレート、又はペンタエリスリトールトリアクリレートである。繰り返し構造を含んだ3官能のアクリレートでは、繰り返し構造の繰り返し回数は、3以上30以下であることが好ましく、3以上20以下であることがより好ましい。

[0071] 繰り返し構造を含んだ4官能のアクリレートは、例えば、EO変性、PO変性又はCL変性させたペンタエリスリトールテトラアクリレートである。

繰り返し構造を含んだ4官能のアクリレートでは、繰り返し構造の繰り返し回数は、12以上であることが好ましく、12以上50以下であることがより好ましく、20以上50以下であることが更に好ましい。

[0072] 上記繰り返し構造の繰り返し回数は、MALDI-TOF-MSを使用することで分析可能である。電離放射線硬化性樹脂は、分子量分布を持つ場合がある。分子量分布がある場合、上記の繰り返し回数は、MALDI-TOF-MSのマスペクトルの最も強いピークを持つ分子量に相当する繰り返し回数とする。

[0073] 表面保護層用塗液は、上述したとおり、シリカ粒子を含んでいる。表面保護層用塗液にシリカ粒子を含有させると、第2照射工程において、塗膜表面に皺をより均一に生じさせることができ、触感の均一性を向上させることに寄与する。

[0074] また、表面保護層用塗液は、シリカ粒子以外の粒子を更に含有していてよい。シリカ粒子以外の粒子としては、例えば、ポリエチレン(PE)ワックス、ポリプロピレン(PP)ワックス、樹脂ビーズなどの有機材料からなる粒子、又は、ガラス、アルミナ、チタニア、ジルコニア、炭酸カルシウム、硫酸バリウムなどの無機材料からなる粒子を用いることができる。

[0075] シリカ粒子を含む上記粒子の平均粒径(D50)は、10 μ m以下であることが好ましい。粒子の平均粒径(D50)は、より好ましくは1 μ m以上8 μ m以下であり、更に好ましくは2 μ m以上6 μ m以下である。大きな粒子を使用した場合、表面保護層5からの粒子の脱落を生じ易く、高い耐傷性を実現することが難しくなる場合がある。粒子が小さい場合、皺を均一に生じさせる効果が小さい。

[0076] ここで、「平均粒径(D50)」は、レーザ回折／散乱式粒子径分布測定装置で測定されるメジアン径(D50)である。なお、表面保護層用塗液が粒子を含んでいる場合、この塗液から得られる表面保護層5も粒子を含むことになる。表面保護層5が含んでいる粒子の平均粒径は、その断面観察を行い、複数の粒子の粒径を実測して平均化した値とすることができる。このよ

うにして得られる値は、レーザ回折／散乱式粒子径分布測定装置で測定されるメジアン径（D50）と実質的に同じ値となる。従って、上述した平均粒径の範囲は、表面保護層5が含んでいる粒子の平均粒径の範囲と読み替えることもできる。

[0077] 表面保護層がシリカ粒子以外の上記粒子を含有する場合、それら粒子の添加量の合計は、一例によれば、電離放射線硬化性樹脂100質量部に対して、0.5質量部以上20質量部以下であることが好ましく、1質量部以上15質量部以下であることがより好ましく、3質量部以上10質量部以下であることが更に好ましい。

[0078] 表面保護層用塗液は、溶媒や、最終製品の機能向上のための添加剤、例えば、抗菌剤及び防カビ剤を更に含むことができる。表面保護層用塗液は、紫外線吸収剤及び光安定剤等の他の添加剤を更に含むことができる。紫外線吸収剤としては、例えば、ベンゾトリアゾール系、ベンゾエート系、ベンゾフェノン系、トリアジン系等を使用することができる。光安定剤としては、例えば、ヒンダードアミン系等を使用することができる。なお、ここに記載する方法によれば、艶調整剤（艶消し添加剤）なしで低い光沢度を有する表面保護層5を形成することができる。

[0079] 後述する第1照射工程を実施する場合、または第3照射工程において、表面保護層用塗液からなる塗膜の全体を紫外線照射によって硬化させる場合、表面保護層用塗液は光開始剤を更に含むことが好ましい。光開始剤としては、特に限定されるものではないが、例えば、ベンゾフェノン系、アセトフェノン系、ベンゾインエーテル系、チオキサントン系光開始剤等が挙げられる。

[0080] 光開始剤の添加量は、電離放射線硬化性樹脂100質量部に対して、0.1質量部以上10質量部以下であることが好ましく、0.25質量部以上8質量部以下であることがより好ましく、0.5質量部以上6質量部以下であることが更に好ましい。光開始剤を0.1質量部より少なくすると、先述の第1照射工程の効果が現れ難くなる。光開始剤を10質量部より多くすると

、塗膜が完全硬化し、その後の第2照射工程で皺形状が形成し難くなる。

[0081] 表面保護層用塗液からなる塗膜を形成した後、好ましくは第1照射工程を実施することにより、塗膜を半硬化させる。第1照射工程では、波長が200nm以上400nm以下程度の波長の光を塗膜へ照射する。第1照射工程の実施により塗膜を半硬化することで、後述の第2照射工程により生ずる皺をより均一に形成することが可能である。また、第1照射工程の照射条件により皺形状の深さを設計し、テクスチャーの調整をすることが可能である。第1照射工程の実施は必須ではなく、求められる製品の性質により実施を判断すればよい。

[0082] 第1照射工程には高圧水銀ランプ、メタルハライドランプや波長200nm以上400nm以下の波長の光を有する単波長LEDランプ等から選択して使用できる。

[0083] 第1照射光の積算光量は、 $2\text{ mJ} / \text{cm}^2$ 以上 $100\text{ mJ} / \text{cm}^2$ 以下とすることが好ましく、 $10\text{ mJ} / \text{cm}^2$ 以上 $80\text{ mJ} / \text{cm}^2$ 以下とすることがより好ましく、 $20\text{ mJ} / \text{cm}^2$ 以上 $60\text{ mJ} / \text{cm}^2$ 以下とすることが更に好ましい。積算光量を少なくすると、先述の第1照射工程の効果が現れ難くなる。積算光量を多くすると、塗膜が完全硬化し、その後の第2照射工程で皺形状が形成され難くなる。

[0084] 表面保護層用塗液からなる塗膜を形成した後、又は第1照射工程を実施した後、第2照射工程を実施する。第2照射工程では、波長が200nm以下の光（以下、第2照射光という）を塗膜へ照射する。表面保護層用塗液が含んでいる電離放射線硬化性樹脂は、第2照射光に対する吸光係数が大きい。それ故、塗膜に入射した第2照射光は、その最表面からの距離が数十乃至数百nmの位置までしか到達できない。従って、第2照射工程では、塗膜の表面領域において架橋反応が進行して極めて薄い硬化膜が形成される一方、他の領域では架橋反応が進行せずに未硬化のままとなる。

[0085] 第2照射工程後の塗膜は、畝状部5Bに対応した皺を表面に有している。本発明者は、第2照射工程によって塗膜表面に皺を生じる理由を以下のように

に考えている。

[0086] 上記の通り、第2照射光は、塗膜の最表面からの距離が数十乃至数百 nm の位置までしか到達できない。即ち、電離放射線硬化性樹脂の架橋反応は、塗膜の表面においてのみ生じる。塗膜の表面に存在しているモノマー等は、第2照射光の照射により、それらが有している官能基を介して架橋することにより硬化膜を形成するが、それらの官能基の全てが塗膜の表面に存在しているモノマー間の架橋に利用される訳ではない。即ち、硬化膜には未架橋の官能基が残留し得る。

[0087] 塗膜の表面から離れた位置に存在しているモノマーには、第2照射光は到達しないので、それらの架橋反応は生じない。しかしながら、塗膜の表面から離れた位置に存在しているモノマーの一部は、硬化膜へと移動し、そこで、架橋反応を生じる。このようにして、架橋反応に関与した分子の数が増加する。

[0088] 塗膜表面における架橋反応に関与する分子の数が増えると、硬化膜の体積が増加する。架橋反応は塗膜の表面でしか生じないので、硬化膜は、厚さ方向へ体積を増やすことはできず、面内方向へ膨張する。その結果、塗膜の表面に皺を生じる。

[0089] 第2照射光は、エキシマVUV (Vacuum Ultra Violet) 光より取り出すことができる。エキシマVUV光は、希ガスや希ガスハライド化合物を使用したランプから生み出すことができる。希ガスや希ガスハライド化合物のガスが封じられたランプに外部から高いエネルギーを有する電子を与えると、放電プラズマ（誘電体バリア放電）が多数発生する。このプラズマ放電により、放電ガス（希ガス）の原子が励起され、瞬間的にエキシマ状態となる。このエキシマ状態から基底状態に戻るときに、そのエキシマ特有の波長領域の光を発する。

[0090] エキシマランプに用いるガスは、200 nm以下の光を発するものであれば、従来用いられた何れのガスであってもよい。ガスとしては、Xe、Ar、Kr等の希ガスや、ArBr、ArF等の希ガスとハロゲンガスとの混合

ガスを用いることができる。エキシマランプは、ガスによって波長（中心波長）が異なり、例えば約172nm（Xe）、約126nm（Ar）、約146nm（Kr）、約165nm（ArBr）、約193nm（ArF）等の波長を有する。

[0091] 光子エネルギーの大きさや、波長と有機物の結合エネルギーとの差を考慮すると、中心波長が172nmのエキシマ光を発するキセノンランプを光源として用いることが好ましい。また、設備維持にかかるコストや材料の入手等を考慮しても、キセノンランプを光源として用いることが好ましい。

[0092] 第2照射工程は、酸素濃度が低い雰囲気下で行う。酸素は、200nm以下の光に対する吸収係数が大きい。従って、第2照射工程は、例えば、窒素ガス雰囲気下で行うことが好ましい。第2照射工程における気相中の酸素濃度、即ち、反応雰囲気中の残留酸素濃度は、2000ppm以下とすることが好ましく、1000ppm以下とすることがより好ましい。

[0093] また、雰囲気中の酸素は、ラジカル重合を阻害する。それ故、反応雰囲気中の残留酸素濃度は、塗膜表面への皺の形成に影響を及ぼす。それ故、反応雰囲気中の残留酸素濃度を変化させると、表面保護層5の表面性状も変化し得る。

[0094] 第2照射光の積算光量は、 0.5 mJ/cm^2 以上 200 mJ/cm^2 以下とすることが好ましく、 1 mJ/cm^2 以上 100 mJ/cm^2 以下とすることがより好ましく、 3 mJ/cm^2 以上 50 mJ/cm^2 以下とすることが更に好ましい。積算光量を少なくすると、硬化膜の面内方向への膨張が小さくなる。積算光量を多くすると、塗膜の表面状態が劣化する。

[0095] 第2照射工程を終了後、第3照射工程を実施する。第3照射工程では、塗膜へ第3放射線又は照射光を照射して、塗膜全体を硬化させる。これにより、表面保護層5を得る。

[0096] 第3放射線又は照射光は、電子線などの電離放射線であるか、又は、第2照射光と比較して波長が長い紫外線である。

[0097] 第3放射線又は照射光が紫外線の場合、第3照射光の積算光量は、 10 m

J/cm^2 以上 $500mJ/cm^2$ 以下とすることが好ましく、 $50mJ/cm^2$ 以上 $400mJ/cm^2$ 以下とすることがより好ましく、 $100mJ/cm^2$ 以上 $300mJ/cm^2$ 以下とすることが更に好ましい。

[0098] 化粧シート1は、例えば、以上の方法により製造することができる。化粧シート1は、他の方法で製造してもよい。例えば、表面保護層5について上述した方法を利用して版を形成し、この版を使用した転写によって、表面に凹凸構造を有する表面保護層5を形成してもよい。

[0099] <3>効果

図1乃至図3を参照しながら説明した化粧シート1は、表面保護層5が上述した表面性状を有している。このような化粧シート1は、ユーザが表面保護層5の表面上で肌を滑らせたときに、ユーザへざらざらした触感と、触感の均一性を与える。即ち、この化粧シート1は、表面保護層5の表面全体に大きな凹凸の存在をユーザに感じさせることを可能とする。

[0100] ユーザへざらざらした触感を与える化粧シート1は、ユーザの肌に触れる機会が多く、化粧シート1で外観を再現すべき物品がざらざらした触感を与えるものである場合の使用に適している。具体的には、化粧シート1は、家具などでの使用に適している。

[0101] 化粧シート1の表面保護層5は、上述した表面性状を有しているので、艶調整剤（艶消し添加剤）を含んでいなくても、低い光沢度を達成し得る。艶調整剤は、樹脂材料により形成した層の撥油性を低下させるため、艶調整剤を含んだ表面保護層は指紋が付き易い。艶調整剤を含まない表面保護層5は、油を吸収し難いため、指紋が付着し難い。また、撥油性に優れた表面保護層5は、油染みや汚染物質の吸着を生じ難い。更に、艶調整剤を含まない表面保護層5は、その表面を引っ掻いた際に艶調整剤の粒子が脱落せず、それ故、そのような表面保護層5を含んだ化粧シート1は、艶変化や引っ掻き傷を生じ難い。

[0102] 上述した方法により、上記の表面性状を有している表面保護層5が得られるのは、以下の理由による。

[0103] 気相中の酸素は、短波長の紫外線を吸収するだけでなく、ラジカル重合を阻害する。気相中に含まれる酸素がラジカル重合へ及ぼす影響は、電離放射線硬化性樹脂からなる塗膜のうち、気相と隣接した部分において最も大きく、塗膜表面からの距離が大きくなるのに従って小さくなる。それ故、第2照射工程において、気相中の酸素濃度を変化させることにより、塗膜表面からの距離と架橋反応の進行度との関係を変化させることができる。

[0104] この関係が変化すると、第2照射工程によって塗膜の表面に生じる硬化膜の厚さや、架橋反応の進行に応じた面内方向への硬化膜の膨張の程度が変化する。硬化膜の厚さや面内方向への硬化膜の膨張の程度には、第2照射工程における積算光量も影響を及ぼす。そして、硬化膜の厚さや面内方向への硬化膜の膨張の程度は、表面保護層の表面性状へ影響を及ぼす。更に、塗膜の厚さも、皺の形成へ影響を及ぼす。

[0105] 従って、例えば、電離放射線硬化性樹脂の組成と、塗膜の厚さと、第2照射工程における気相中の酸素濃度と、第2照射工程における積算光量とを適宜設定することにより、所望の表面性状を有する表面保護層を得ることができる。

実施例

[0106] 以下に、本発明の例を記載する。

<例1>

図1乃至図3を参照しながら説明した化粧シート1を、以下の方法により製造した。なお、本例では、透明樹脂層4、プライマ層6、接着層7及び隠蔽層8は省略した。

[0107] 先ず、坪量50g/m²の含浸紙（GFR-506：興人（株）製）を、原反層2として準備した。原反層2の一方の面に対して、油性硝化綿樹脂系グラビア印刷インキ（PCNT（PCRNT）各色：東洋インキ（株）製）を使用して、絵柄層3を形成した。

[0108] 次いで、絵柄層3上に、表面保護層用塗液を塗布した。表面保護層用塗液としては、下記の電離放射線硬化性樹脂に、下記の粒子を配合してなるもの

を使用した。

・電離放射線硬化性樹脂

種類：エチレングリコールジアクリレート（EO9モル付加）

品名：ライトアクリレート9EG-A（共栄社化学社製）

配合：100質量部

・粒子

品名：サイリシア（登録商標）250N（富士シリシア化学社製）

粒径：5 μm

配合：2質量部

・開始剤

品名：Irgacure 184（BASFジャパン株式会社）

配合：1質量部

表面保護層用塗液からなる塗膜は、厚さが10 μm となるように形成した

。

[0109] その後、第1照射工程を実施した。具体的には大気中で、表面保護層用塗液からなる塗膜の表面に対して、波長365 nmの紫外線を主波長とする高圧水銀ランプを用いて、積算光量が50 mJ / cm^2 となるように照射した。これにより、塗膜を半硬化させた。

[0110] 続いて、第2照射工程を実施した。具体的には、大気圧下、酸素濃度が500 ppmの窒素ガス雰囲気中で、塗膜へXeエキシマランプを用いて、波長172 nmの紫外線を積算光量が150 mJ / cm^2 となるように照射した。これにより、塗膜の表面に皺を生じさせた。

[0111] 続いて、第3照射工程を実施した。具体的には、塗膜へ電離放射線を照射して、その全体を硬化させることで、表面保護層5を形成した。

以上のようにして、化粧シート1を得た。

[0112] <例2>

以下の点を除き、例1と同様の方法により化粧シート1を製造した。即ち、本例では、下記の電離放射線硬化性樹脂を使用した。

- ・電離放射線硬化性樹脂

種類：トリメチロールプロパンEO変性トリアクリレート（EO6モル付加）

品名：Miramer M3160（Miwon社製）

そして、第2照射工程は、大気圧下、酸素濃度が500ppmの窒素ガス雰囲気中で、表面保護層用塗液からなる塗膜の表面に対して、Xeエキシマランプを用いて、波長172nmの紫外線を積算光量が150mJ/cm²となるように照射した。

[0113] <例3>

以下の点を除き、例2と同様の方法により化粧シート1を製造した。即ち、本例では、下記の粒子の配合量を変更した。

- ・粒子

品名：サイリシア250N（富士シリシア化学社製）

粒径：5μm

配合：1.3質量部

[0114] <例4>

以下の点を除き、例2と同様の方法により化粧シート1を製造した。即ち、本例では、下記の粒子の配合量を変更した。

- ・粒子

品名：サイリシア250N（富士シリシア化学社製）

粒径：5μm

配合：1.5質量部

[0115] <例5>

以下の点を除き、例2と同様の方法により化粧シート1を製造した。即ち、本例では、下記の粒子の配合量を変更した。

- ・粒子

品名：サイリシア250N（富士シリシア化学社製）

粒径：5μm

配合：22質量部

[0116] <例6>

以下の点を除き、例1と同様の方法により化粧シート1を製造した。即ち、本例では、下記の電離放射線硬化性樹脂を使用した。

・電離放射線硬化性樹脂

種類：トリメチロールプロパンEO変性トリアクリレート（EO15モル付加）

品名：SR9035（Sartomer社製）

そして、第2照射工程は、大気圧下、酸素濃度が500ppmの窒素ガス雰囲気中で、表面保護層用塗液からなる塗膜の表面に対して、Xeエキシマランプを用いて、波長172nmの紫外線を積算光量が150mJ/cm²となるように照射した。

[0117] <例7>

以下の点を除き、例1と同様の方法により化粧シート1を製造した。即ち、本例では、下記の電離放射線硬化性樹脂を使用した。

・電離放射線硬化性樹脂

種類：トリメチロールプロパンEO変性トリアクリレート（EO3モル付加）

品名：Miramer M3130（Miwon社製）

そして、第2照射工程は、大気圧下、酸素濃度が200ppmの窒素ガス雰囲気中で、表面保護層用塗液からなる塗膜の表面に対して、Xeエキシマランプを用いて、波長172nmの紫外線を積算光量が200mJ/cm²となるように照射した。

[0118] <例8>

以下の点を除き、例1と同様の方法により化粧シート1を製造した。即ち、本例では、下記の電離放射線硬化性樹脂を使用した。

・電離放射線硬化性樹脂

種類：トリメチロールプロパンPO変性トリアクリレート（PO6モル付

加)

品名：NKエステルA-TMP-T-6PO（新中村化学社製）

そして、第2照射工程は、大気圧下、酸素濃度が500ppmの窒素ガス雰囲気中で、表面保護層用塗液からなる塗膜の表面に対して、Xeエキシマランプを用いて、波長172nmの紫外線を積算光量が150mJ/cm²となるように照射した。

[0119] <例9>

以下の点を除き、例1と同様の方法により化粧シート1を製造した。即ち、本例では、下記の電離放射線硬化性樹脂を使用した。

・電離放射線硬化性樹脂

種類：カプロラクトン変性トリスー（2-アクリロキシエチル）イソシアヌレート（カプロラクトン（CL）3モル付加）

品名：NKエステルA-9300-3CL（新中村化学社製）

そして、第2照射工程は、大気圧下、酸素濃度が200ppmの窒素ガス雰囲気中で、表面保護層用塗液からなる塗膜の表面に対して、Xeエキシマランプを用いて、波長172nmの紫外線を積算光量が200mJ/cm²となるように照射した。

[0120] <例10>

以下の点を除き、例1と同様の方法により化粧シート1を製造した。即ち、本例では、下記の電離放射線硬化性樹脂を使用した。表面保護層用塗液からなる塗膜は、厚さが8μmとなるように形成した。

・電離放射線硬化性樹脂

種類：トリメチロールプロパンEO変性トリアクリレート（EO6モル付加）

品名：Miramer M3160（Miwon社製）

そして、第2照射工程は、大気圧下、酸素濃度が500ppmの窒素ガス雰囲気中で、表面保護層用塗液からなる塗膜の表面に対して、Xeエキシマランプを用いて、波長172nmの紫外線を積算光量が150mJ/cm²と

なるように照射した。

[0121] <例 1 1>

以下の点を除き、例 1 と同様の方法により化粧シート 1 を製造した。即ち、本例では、下記の電離放射線硬化性樹脂を使用した。表面保護層用塗液からなる塗膜は、厚さが $15\ \mu\text{m}$ となるように形成した。

・電離放射線硬化性樹脂

種類：トリメチロールプロパンEO変性トリアクリレート（EO 6 モル付加）

品名：Miramer M3160（Miwon社製）

そして、第2照射工程は、大気圧下、酸素濃度が $200\ \text{ppm}$ の窒素ガス雰囲気中で、表面保護層用塗液からなる塗膜の表面に対して、Xeエキシマランプを用いて、波長 $172\ \text{nm}$ の紫外線を積算光量が $200\ \text{mJ}/\text{cm}^2$ となるように照射した。

[0122] <例 1 2>

以下の点を除き、例 1 と同様の方法により化粧シート 1 を製造した。即ち、本例では、下記の電離放射線硬化性樹脂を使用した。

・電離放射線硬化性樹脂

種類：エトキシ化ペンタエリスリトールテトラアクリレート（EO 35 モル付加）

品名：NKエステル ATM-35E（新中村化学工業社製）

そして、第2照射工程は、大気圧下、酸素濃度が $200\ \text{ppm}$ の窒素ガス雰囲気中で、表面保護層用塗液からなる塗膜の表面に対して、Xeエキシマランプを用いて、波長 $172\ \text{nm}$ の紫外線を積算光量が $150\ \text{mJ}/\text{cm}^2$ となるように照射した。

[0123] <例 1 3>

以下の点を除き、例 1 と同様の方法により化粧シート 1 を製造した。即ち、本例では、下記の電離放射線硬化性樹脂を使用した。

・電離放射線硬化性樹脂

種類：エトキシ化ペンタエリスリトールテトラアクリレート（E O 5 0 モル付加）

そして、第2照射工程は、大気圧下、酸素濃度が200ppmの窒素ガス雰囲気中で、表面保護層用塗液からなる塗膜の表面に対して、Xeエキシマランプを用いて、波長172nmの紫外線を積算光量が150mJ/cm²となるように照射した。

[0124] <例14>

以下の点を除き、例1と同様の方法により化粧シート1を製造した。即ち、本例では、下記の電離放射線硬化性樹脂を使用した。

・電離放射線硬化性樹脂

種類：エトキシ化ペンタエリスリトールテトラアクリレート（E O 2 0 モル付加）

そして、第2照射工程は、大気圧下、酸素濃度が100ppmの窒素ガス雰囲気中で、表面保護層用塗液からなる塗膜の表面に対して、Xeエキシマランプを用いて、波長172nmの紫外線を積算光量が200mJ/cm²となるように照射した。

[0125] <例15>

以下の点を除き、例1と同様の方法により化粧シート1を製造した。即ち、本例では、下記の電離放射線硬化性樹脂を使用した。

・電離放射線硬化性樹脂

種類：プロポキシ化ペンタエリスリトールテトラアクリレート（P O 3 5 モル付加）そして、第2照射工程は、大気圧下、酸素濃度が200ppmの窒素ガス雰囲気中で、表面保護層用塗液からなる塗膜の表面に対して、Xeエキシマランプを用いて、波長172nmの紫外線を積算光量が150mJ/cm²となるように照射した。

[0126] <例16>

以下の点を除き、例1と同様の方法により化粧シート1を製造した。即ち、本例では、下記の電離放射線硬化性樹脂を使用した。

・電離放射線硬化性樹脂

種類：カプロラクトン変性ペンタエリスリトールテトラアクリレート（C L 2 0 モル付加）

そして、第2照射工程は、大気圧下、酸素濃度が100ppmの窒素ガス雰囲気中で、表面保護層用塗液からなる塗膜の表面に対して、Xeエキシマランプを用いて、波長172nmの紫外線を積算光量が200mJ/cm²となるように照射した。

[0127] <例17>

以下の点を除き、例1と同様の方法により化粧シート1を製造した。即ち、本例では、下記の電離放射線硬化性樹脂を使用した。表面保護層用塗液からなる塗膜は、厚さが8μmとなるように形成した。

・電離放射線硬化性樹脂

種類：エトキシ化ペンタエリスリトールテトラアクリレート（EO35モル付加）

品名：NKエステル ATM-35E（新中村化学工業社製）

そして、第2照射工程は、大気圧下、酸素濃度が200ppmの窒素ガス雰囲気中で、表面保護層用塗液からなる塗膜の表面に対して、Xeエキシマランプを用いて、波長172nmの紫外線を積算光量が150mJ/cm²となるように照射した。

[0128] <例18>

以下の点を除き、例1と同様の方法により化粧シート1を製造した。即ち、本例では、下記の電離放射線硬化性樹脂を使用した。表面保護層用塗液からなる塗膜は、厚さが15μmとなるように形成した。

・電離放射線硬化性樹脂

種類：エトキシ化ペンタエリスリトールテトラアクリレート（EO35モル付加）

そして、第2照射工程は、大気圧下、酸素濃度が200ppmの窒素ガス雰囲気中で、表面保護層用塗液からなる塗膜の表面に対して、Xeエキシマ

ランプを用いて、波長 172 nm の紫外線を積算光量が 200 mJ / cm² となるように照射した。

[0129] <例 19>

以下の点を除き、例 1 と同様の方法により化粧シート 1 を製造した。即ち、本例では、下記の電離放射線硬化性樹脂を使用した。

・電離放射線硬化性樹脂

種類：：エトキシ化ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート（EO 12 モル付加）そして、第 2 照射工程は、大気圧下、酸素濃度が 100 ppm の窒素ガス雰囲気中で、表面保護層用塗液からなる塗膜の表面に対して、Xe エキシマランプを用いて、波長 172 nm の紫外線を積算光量が 200 mJ / cm² となるように照射した。

[0130] <比較例 1>

以下の点を除き、例 1 と同様の方法により化粧シートを製造した。即ち、本例では、表面保護層用塗液としては、下記の電離放射線硬化性樹脂に、下記の粒子を配合してなるものを使用した。

・電離放射線硬化性樹脂

種類：トリメチロールプロパンEO変性トリアクリレート（EO 6 モル付加）

品名：Miramer M3160（Miwon 社製）

配合：100 質量部

・粒子

品名：サイリシア 250N（富士シリシア化学社製）

粒径：5 μm

配合：15 質量部

そして、第 1 及び第 2 照射工程は行わず、表面保護層用塗液からなる塗膜は、第 3 照射工程のみによって硬化させた。

[0131] <比較例 2>

以下の点を除き、例 1 と同様の方法により化粧シートを製造した。即ち、

本例では、表面保護層用塗液としては、下記の電離放射線硬化性樹脂に、下記の粒子を配合してなるものを使用した。

・電離放射線硬化性樹脂

種類：エトキシ化ペンタエリスリトールテトラアクリレート（EO35モル付加）

品名：NKエステル ATM-35E（新中村化学工業社製）

配合：100質量部

・粒子

品名：サイリシア250N（富士シリシア化学社製）

粒径：5 μm

配合：15質量部

そして、第1及び第2照射工程は行わず、表面保護層用塗液からなる塗膜は、第3照射工程のみによって硬化させた。

[0132] <比較例3>

以下の点を除き、例1と同様の方法により化粧シートを製造した。即ち、本例では、下記の電離放射線硬化性樹脂を使用した。表面保護層用塗液からなる塗膜は、厚さが5 μm となるように形成した。

・電離放射線硬化性樹脂

種類：トリメチロールプロパンEO変性トリアクリレート（EO6モル付加）

品名：Miramer M3160（Miwon社製）

そして、第2照射工程は、大気圧下、酸素濃度が500ppmの窒素ガス雰囲気中で、表面保護層用塗液からなる塗膜の表面に対して、Xeエキシマランプを用いて、波長172nmの紫外線を積算光量が50mJ/cm²となるように照射した。

[0133] <比較例4>

以下の点を除き、例1と同様の方法により化粧シートを製造した。即ち、本例では、下記の電離放射線硬化性樹脂を使用した。表面保護層用塗液から

なる塗膜は、厚さが $5\mu\text{m}$ となるように形成した。

・電離放射線硬化性樹脂

種類：エトキシ化ペンタエリスリトールテトラアクリレート（EO35モル付加）

品名：NKエステル ATM-35E（新中村化学工業社製）

そして、第2照射工程は、大気圧下、酸素濃度が 200ppm の窒素ガス雰囲気中で、表面保護層用塗液からなる塗膜の表面に対して、Xeエキシマランプを用いて、波長 172nm の紫外線を積算光量が $50\text{mJ}/\text{cm}^2$ となるように照射した。

[0134] <比較例5>

以下の点を除き、例1と同様の方法により化粧シートを製造した。即ち、本例では、粒子（サイリシア250N）を配合しなかった。

[0135] <評価>

上記の化粧シートの各々に対し、以下に記載する評価を行った。

[0136] （1）光沢度

光沢度は、Rhopoint IQ（コニカミノルタ社製）を用いて、 60° 度光沢度を測定した。以下の表1乃至表3における「 60° 度光沢値」は、この 60° 度光沢度を表している。

[0137] （2）肌感触

肌感触（ざらざら触感）は、以下の方法により評価した。

まず、評価者間で評価基準を一致させるための事前準備を行った。具体的には、表面性状が異なる10個の標準試験片を準備した。次に、20名の評価者の各々に、目隠しした状態で標準試験片の表面上で指を滑らせてもらい、その後、触感を以下の5つの群に分類してもらった。

[0138] 第1群：凹凸の存在を明確に感じ、強いざらざら触感があった。

第2群：ざらざら触感（第1群と第3群の中間のざらざら触感）があった。

第3群：わずかなざらざら触感があった。

第4群：ざらざら触感はなかった。

[0139] 各評価者による評価が連続して3回以上一致し、且つ、評価者間で評価結果が連続して3回一致するまで、以上の手順を繰り返した。

[0140] 次に、化粧シートの各々について、上記評価者の各々に、目隠しした状態で表面保護層の表面上で指を滑らせてもらい、その後、触感を上記の5つの群に分類してもらった。そして、各評価者による評価が連続して3回以上一致し、且つ、評価者間で評価結果が連続して3回一致するまで、この手順を繰り返した。この結果から、以下の基準に従って肌触感を評価した。

A A A : 第1群

A A : 第2群

A : 第3群

B : 第4群。

[0141] (3) 触感の均一性

肌触感の評価を行った上記20名の評価者が、肌触感の評価に次いで、以下の方法により触感の均一性の評価を行った。

各化粧シートから縦10cm×横10cmのサイズの試験片を切り出した。上記20名の評価者の各々に、目隠しした状態で各試験片の表面保護層の表面全体にわたって指を自由に滑らせてもらい、肌触感（ざらざら触感）の変化の有無又は程度から、触感の均一性を以下の3つの群に分類してもらった。

[0142] 第1群：肌触感（ざらざら触感）が異なるように感じられる箇所はなかった。

第2群：肌触感（ざらざら触感）が異なるように感じられる箇所はあったが、変化の程度はわずかであった。

第3群：肌触感（ざらざら触感）がはっきり異なるように感じられる箇所があった。

[0143] そして、各評価者による評価が連続して3回以上一致し、且つ、評価者間で評価結果が連続して3回一致するまで、この手順を繰り返した。この結果

から、以下の基準に従って触感の均一性を評価した。なお、肌触感の評価が B であった比較例 1 乃至 4 の化粧シートについては、この評価は行わなかった。

AA : 第 1 群

A : 第 2 群

B : 第 3 群。

[0144] (4) 耐指紋性

耐指紋性評価として、指紋のふき取り性評価を実施した。

具体的には、先ず、各化粧シートの表面の 60 度光沢度を測定して、この 60 度光沢度を初期光沢度とした。続いて、表面保護層上に耐指紋評価液を付着させ、化粧シート表面に付着した耐指紋評価液を拭き取った。ここでは、耐指紋評価液として、高級脂肪酸を用いた。その後、耐指紋評価液を拭き取った部分の 60 度光沢度を測定して、この 60 度光沢度を拭き取り後光沢度とした。

[0145] 指紋拭き取り率は、下記の式から算出した。

$$\text{指紋拭き取り率 (\%)} = (\text{拭き取り後光沢度} / \text{初期光沢度}) \times 100$$

評価基準は、下記の通りとした。

[0146] AA : 70%以上 250%未満

A : 50%以上 70%未満、又は、250%以上 300%未満

B : 50%未満、又は、300%以上。

[0147] (5) 耐汚染性

耐汚染性評価として、日本農林規格 (JAS : Japanese Agricultural Standards) に規定された汚染 A 試験を行った。即ち、各化粧シートの表面保護層に、青色インキ、黒色速乾性インキ及び赤色クレヨンで各々の幅が 10 mm の線を引き、4 時間放置した。その後、エタノールを含ませた布で、青色インキ、黒色速乾性インキ及び赤色クレヨンの線を拭き取った。

[0148] 評価基準は、下記の通りとした。

AA : 各色の線を容易に拭き取ることができた。

A : 各色の線の一部を拭き取ることができたが、一部に汚れが残った

。

B : 各色の線を拭き取ることができなかった。

[0149] (6) 耐傷性試験

ウレタン系の接着剤を用いて、各化粧シートを木質基板Bに貼り付けた。その後、耐傷性評価として、スチールウールラビング試験を実施した。具体的には、100gの荷重をかけながらスチールウールで化粧シートを20往復擦り、化粧シートの表面に生じた傷や光沢の変化を目視にて確認した。

[0150] 評価基準は、下記の通りとした。

AA : 表面に傷や光沢の変化が発生しなかった。

A : 表面に軽微な傷や光沢の変化が発生した。

B : 表面に著しい傷や光沢の変化が発生した。

[0151]

[表1]

表 1		例 1	例 2	例 3	例 4	例 5	例 6	例 7	例 8	例 9	例 10
表面形状		形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状
突出山部高さ	Rpk (μm)	4.2	4.3	4.1	3.9	4.2	4.3	3.8	4.4	3.8	3.6
粗さ曲線要素	RSm (μm)	263.6	286.5	264.9	274.3	298.5	161.5	331.7	231.9	378.3	254.2
{Si/(C+O+Si)}×100		0.8	0.8	0.5	5.0	7.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
厚さ (μm)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	8
アクリル樹脂	官能基数	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	繰り返し構造	C2H4O	C2H4O	C2H4O	C2H4O	C2H4O	C2H4O	C2H4O	C3H6O	C6H10O2	C2H4O
	繰り返し構造	9	6	6	6	6	15	3	6	3	6
60度光沢値		2.3	2.1	2.7	1.7	1.2	1.6	3.6	2.4	3.7	2.6
肌感触		AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	A
ざらざら		AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
触感の均一性		AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
耐指紋性		AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
耐汚染性		AA	AA	AA	AA	B	AA	AA	AA	AA	AA
耐傷性		B	AA	AA	AA	B	AA	AA	AA	AA	AA

[表2]

表2

		例11	例12	例13	例14	例15	例16	例17	例18	例19
表面形状		歛状	歛状	歛状	歛状	歛状	歛状	歛状	歛状	歛状
突出山部高さ	Rpk (μm)	7.2	4.2	4.6	3.6	4.1	3.7	3.5	7.1	3.5
粗さ曲線要素	RSm (μm)	348.5	296.0	174.2	359.5	249.2	342.7	261.4	375.2	411.9
$\{Si/(C+O+Si)\} \times 100$		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
厚さ (μm)		15	10	10	10	10	10	8	15	10
アクリル樹脂	官能基数	3	4	4	4	4	4	4	4	6
	繰り返し構造	C2H4O	C2H4O	C2H4O	C2H4O	C3H6O	C6H10O2	C2H4O	C2H4O	C2H4O
	繰り返し回数	6	35	50	20	35	20	35	35	12
60度光沢値		2.0	2.2	1.5	3.6	2.4	4.1	2.6	2.1	6.1
肌感触	ざらざら	AAA	AA	AA	AA	AA	AA	A	AAA	AA
触感の均一性		AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
耐指紋性		AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
耐汚染性		AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
耐傷性		AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA

[表3]

表3

表面形状	比較例1 粒子による 凹凸		比較例2 粒子による 凹凸		比較例3 凹凸		比較例4 凹凸		比較例5 凹凸	
	Rpk (μm)	RSm (μm)	Rpk (μm)	RSm (μm)	Rpk (μm)	RSm (μm)	Rpk (μm)	RSm (μm)	Rpk (μm)	RSm (μm)
表面粗さ	0.5	1102.8	0.5	1058.6	2.6	311.5	2.6	308.5	6.2	384.1
{Si/(C+O+Si)}×100	7.0	7.0	7.0	7.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0
厚さ (μm)	10	10	10	10	5	5	5	5	10	10
アクリル樹脂	官能基数		官能基数		官能基数		官能基数		官能基数	
	繰り返し構造	繰り返し回数	繰り返し構造	繰り返し回数	繰り返し構造	繰り返し回数	繰り返し構造	繰り返し回数	繰り返し構造	繰り返し回数
60度光沢値	6	10	35	10	6	30	35	28	6	32
肌感触	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
触感の均一性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
耐指紋性	B	B	B	B	AA	AA	AA	AA	AA	AA
耐汚染性	B	B	B	B	AA	AA	AA	AA	AA	AA
耐傷性	B	B	B	B	AA	AA	AA	AA	AA	AA

[0154] 表1及び表2に示すように、例1乃至19に係る化粧シートは、評価者へざらざらした触感と触感の均一性を与えた。また、例1乃至19に係る化粧シートは、低光沢であり、耐指紋性に優れていた。更に、例1乃至4及び例6乃至19に係る化粧シートは、耐汚染性にも優れていた。また、例2乃至4及び例6乃至19に係る化粧シートは、耐傷性にも優れていた。これに対し、比較例1及び2に係る化粧シートは、表3に示すように、評価者へざらざらした触感を与えず、耐指紋性、耐汚染性及び耐傷性の何れにも劣っていた。また、比較例3及び4に係る化粧シートは、低光沢であり、耐指紋性、

耐汚染性及び耐傷性に優れていたものの、評価者へざらざらした触感を与えなかった。また、比較例 5 に係る化粧シートは、低光沢であり、耐指紋性、耐汚染性及び耐傷性に優れ、更に評価者へざらざらした触感を与えるものの、触感の均一性に劣っていた。

符号の説明

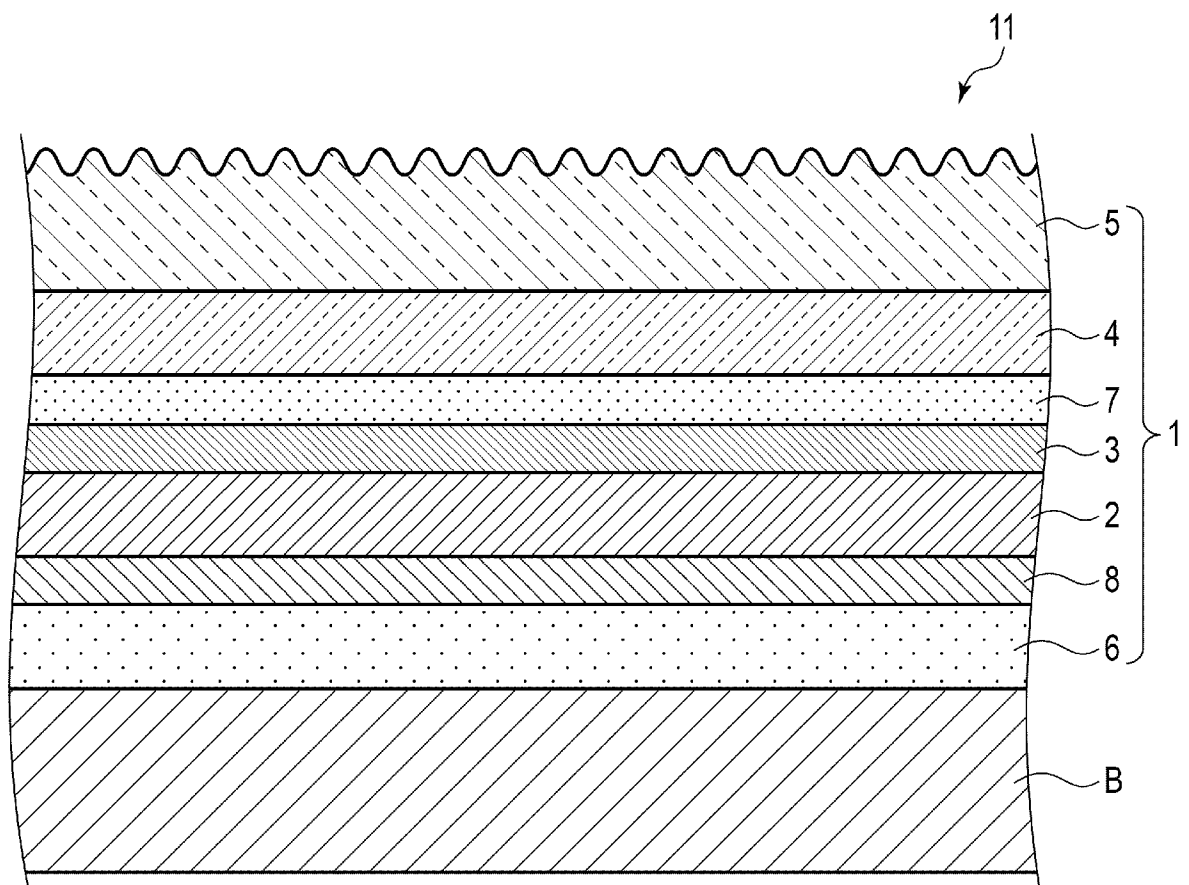
[0155] 1…化粧シート、2…原反層、3…絵柄層、4…透明樹脂層、5…表面保護層、5 B…畝状部、6…プライマ層、7…接着層、8…隠蔽層、11…化粧材、B…基板。

請求の範囲

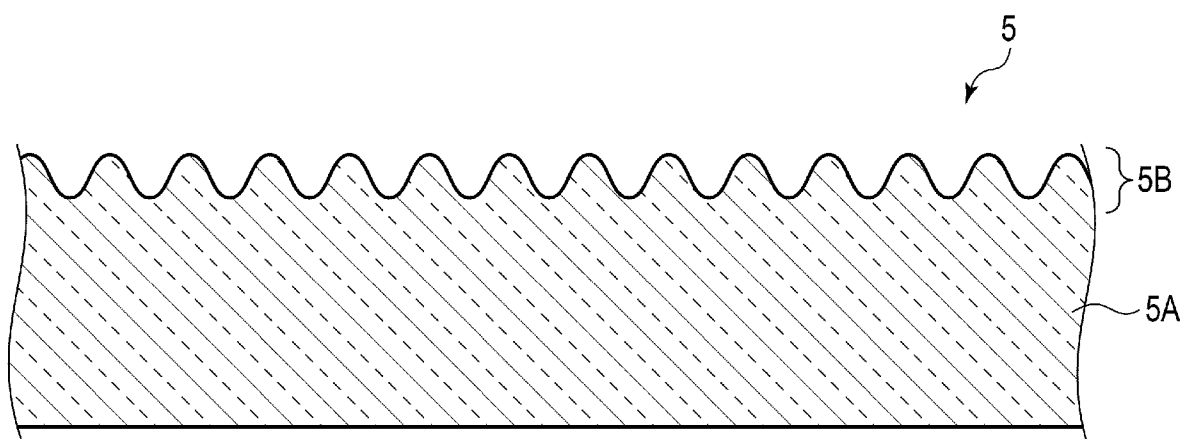
- [請求項1] 原反層と、前記原反層の一方の表面に設けられた表面保護層とを備え、
- 前記表面保護層の表面に、各々が畝状に突出した複数の畝状部を含んだ凹凸構造が設けられており、
- 前記表面保護層の前記凹凸構造は、突出山部高さ R_{pk} が $3.5 \mu m$ 以上であり、
- 前記表面保護層は、炭素原子の質量濃度 C （質量％）と酸素原子の質量濃度 O （質量％）とケイ素原子の質量濃度 Si （質量％）とが、以下の関係式：
- $$0.5 \leq \{ Si / (C + O + Si) \} \times 100$$
- を満たす化粧シート。
- [請求項2] 前記突出山部高さ R_{pk} は $25 \mu m$ 以下である請求項1に記載の化粧シート。
- [請求項3] 前記表面保護層は、炭素原子の質量濃度 C （質量％）と酸素原子の質量濃度 O （質量％）とケイ素原子の質量濃度 Si （質量％）とが、以下の関係式：
- $$0.5 \leq \{ Si / (C + O + Si) \} \times 100 \leq 5.0$$
- を満たす請求項1又は2に記載の化粧シート。
- [請求項4] 前記表面保護層の前記凹凸構造は、粗さ曲線要素の平均長さ R_{Sm} が $150 \mu m$ 以上である請求項1乃至3の何れか1項に記載の化粧シート。
- [請求項5] 前記平均長さ R_{Sm} は $600 \mu m$ 以下である請求項4に記載の化粧シート。
- [請求項6] 前記表面保護層の厚さは $8 \mu m$ 以上である請求項1乃至5の何れか1項に記載の化粧シート。
- [請求項7] 前記表面保護層の光沢度は 10.0 以下である請求項1乃至6の何れか1項に記載の化粧シート。

- [請求項8] 前記複数の畝状部の少なくとも一部は幅方向へ隣り合い、前記複数の畝状部の前記少なくとも一部が前記幅方向へ隣り合った位置で、前記幅方向及び前記表面保護層の厚さ方向に平行な断面は、前記凹凸構造が設けられた部分が正弦波形状を有している請求項1乃至7の何れか1項に記載の化粧シート。
- [請求項9] 前記表面保護層は電離放射線硬化性樹脂の硬化物を含み、前記電離放射線硬化性樹脂は主成分が繰り返し構造を含むアクリレートであり、
前記繰り返し構造は、エチレンオキサイド、プロピレンオキサイド、及び ϵ -カプロラク톤の何れかであり、
前記繰り返し構造の繰り返し回数は3以上である請求項1乃至8の何れか1項に記載の化粧シート。
- [請求項10] 請求項1乃至9の何れか1項に記載の化粧シートと、
前記化粧シートが貼り付けられた基材と
を備えた化粧材。

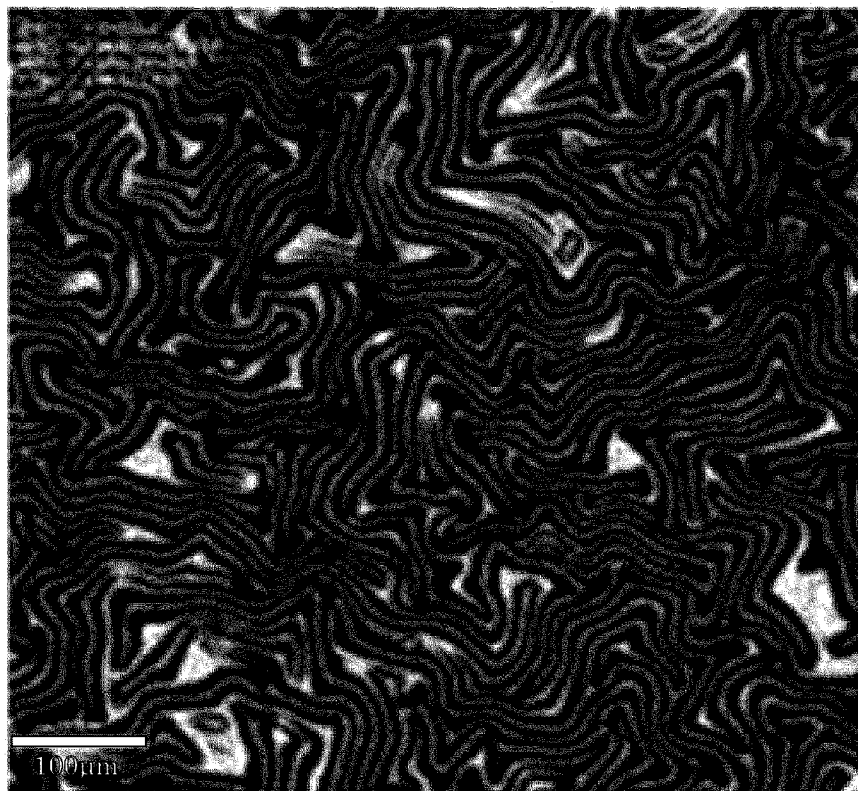
[図1]



[図2]



[図3]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2023/046694

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**B32B 3/30**(2006.01)i; **B32B 7/023**(2019.01)i; **B32B 27/00**(2006.01)i; **B32B 27/16**(2006.01)i

FI: B32B3/30; B32B7/023; B32B27/00 E; B32B27/16 101

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

B32B1/00-43/00; C08J5/00-5/22; E04F15/00-15/22

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan 1922-1996
 Published unexamined utility model applications of Japan 1971-2024
 Registered utility model specifications of Japan 1996-2024
 Published registered utility model applications of Japan 1994-2024

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 2022/239270 A1 (TOPPAN PRINTING CO., LTD.) 17 November 2022 (2022-11-17) entire text	1-10
A	JP 2021-137990 A (TOPPAN PRINTING CO., LTD.) 16 September 2021 (2021-09-16) entire text	1-10
A	JP 2007-185606 A (NIPPON PAINT CO., LTD.) 26 July 2007 (2007-07-26) entire text	1-10
A	JP 2018-144437 A (TOPPAN PRINTING CO., LTD.) 20 September 2018 (2018-09-20) entire text	1-10
A	WO 2017/033972 A1 (TOPPAN PRINTING CO., LTD.) 02 March 2017 (2017-03-02) entire text	1-10
A	JP 2020-75420 A (TOPPAN PRINTING CO., LTD.) 21 May 2020 (2020-05-21) entire text	1-10

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
 “D” document cited by the applicant in the international application
 “E” earlier application or patent but published on or after the international filing date
 “L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
 “O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
 “P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

21 February 2024

Date of mailing of the international search report

05 March 2024

Name and mailing address of the ISA/JP

Japan Patent Office (ISA/JP)
 3-4-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915
 Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/JP2023/046694

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
WO	2022/239270	A1	17 November 2022	US	2023/0146524	A1	
				EP	4116095	A1	
				CN	115623867	A	

JP	2021-137990	A	16 September 2021	US	2023/0041625	A1	
				WO	2021/149480	A1	
				EP	4094934	A1	
				KR	10-2022-0113746	A	
				CN	114945463	A	
				AU	2021210701	A	

JP	2007-185606	A	26 July 2007	(Family: none)			

JP	2018-144437	A	20 September 2018	(Family: none)			

WO	2017/033972	A1	02 March 2017	US	2018/0264791	A1	
				EP	3342589	A1	
				AU	2016311950	A	
				CN	107921765	A	
				KR	10-2018-0042265	A	
				TW	201713506	A	

JP	2020-75420	A	21 May 2020	(Family: none)			

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC）） B32B 3/30(2006.01)i; B32B 7/023(2019.01)i; B32B 27/00(2006.01)i; B32B 27/16(2006.01)i FI: B32B3/30; B32B7/023; B32B27/00 E; B32B27/16 101		
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC）） B32B1/00-43/00; C08J5/00-5/22; E04F15/00-15/22 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2024年 日本国実用新案登録公報 1996-2024年 日本国登録実用新案公報 1994-2024年 国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	WO 2022/239270 A1（凸版印刷株式会社）17.11.2022（2022-11-17） 文献全体	1-10
A	JP 2021-137990 A（凸版印刷株式会社）16.09.2021（2021-09-16） 文献全体	1-10
A	JP 2007-185606 A（日本ペイント株式会社）26.07.2007（2007-07-26） 文献全体	1-10
A	JP 2018-144437 A（凸版印刷株式会社）20.09.2018（2018-09-20） 文献全体	1-10
A	WO 2017/033972 A1（凸版印刷株式会社）02.03.2017（2017-03-02） 文献全体	1-10
A	JP 2020-75420 A（凸版印刷株式会社）21.05.2020（2020-05-21） 文献全体	1-10
☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☒ パテントファミリーに関する別紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー “A” 特に関連のある文献ではなく、一般的な技術水準を示すもの “D” 国際出願で出願人が先行技術文献として記載した文献 “E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの “L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） “O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 “P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献 “T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの “X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの “Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの “&” 同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日 21.02.2024	国際調査報告の発送日 05.03.2024	
名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 〒100-8915 日本国 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	権限のある職員（特許庁審査官） 鏡 宣宏 4S 9341 電話番号 03-3581-1101 内線 3430	

国際調査報告
 パテントファミリーに関する情報

国際出願番号

PCT/JP2023/046694

引用文献			公表日	パテントファミリー文献			公表日
WO	2022/239270	A1	17.11.2022	US	2023/0146524	A1	
				EP	4116095	A1	
				CN	115623867	A	

JP	2021-137990	A	16.09.2021	US	2023/0041625	A1	
				WO	2021/149480	A1	
				EP	4094934	A1	
				KR	10-2022-0113746	A	
				CN	114945463	A	
				AU	2021210701	A	

JP	2007-185606	A	26.07.2007	(ファミリーなし)			

JP	2018-144437	A	20.09.2018	(ファミリーなし)			

WO	2017/033972	A1	02.03.2017	US	2018/0264791	A1	
				EP	3342589	A1	
				AU	2016311950	A	
				CN	107921765	A	
				KR	10-2018-0042265	A	
				TW	201713506	A	

JP	2020-75420	A	21.05.2020	(ファミリーなし)			
